

装置等目録

- 1 防汚膜装置「Gener - 2350」
- 2 基体保持手段の基体保持面の全域に向け成膜材料を供給することによって前記基体保持面に保持され回転している基体のすべてに対して前記成膜材料を連続して供給するとともに、前記基体保持面の一部の領域に向けイオンを照射することによって前記基体の一部に対して前記イオンを連続して照射することによるアシスト効果を与えながら、前記基体の表面に薄膜を堆積させることを特徴とする成膜方法。